



## **NEUE MULTIFUNKTIONALE MIKRO- UND NANOIMPRINT-LÖSUNG VON EV GROUP BIETET BEISPIELLOSE FLEXIBILITÄT FÜR DIE VOLUMENPRODUKTION OPTISCHER BAUELEMENTE**

*Der EVG®7300 ist das fortschrittlichste EVG-System, welches mehrere UV-basierte Prozesse, wie Nanoimprint-Lithographie (NIL), Linsenprägen und das Stapeln von Linsen (UV-Bonding) in einer gemeinsamen Plattform vereint*

**ST. FLORIAN AM INN, Österreich, 18. Januar 2022**— EV Group (EVG), ein führender Entwickler und Hersteller von Anlagen für Waferbonding- und Lithographieanwendungen in der Halbleiterindustrie, Mikrosystemtechnik und Nanotechnologie, stellt heute das automatisierte EVG®7300 SmartNIL® Nanopräge- und Wafer-Level-Optics-System vor. Der EVG7300 ist die fortschrittlichste Lösung des Unternehmens, die mehrere UV-basierte Prozesse, wie Nanoimprint-Lithographie (NIL), Linsenprägen und Linsenstapelung (UV-Bonden) in einer einzigen Plattform vereint. Dieses für die Industrie entwickelte, multifunktionale System ist konzipiert, um den Anforderungen in anspruchsvollen F&E- und Produktionsumgebungen für eine breite Palette neuer Anwendungen gerecht zu werden, welche Mikro- und Nanostrukturierung sowie das Stapeln funktionaler Schichten benötigen. Dazu gehören Wafer-Level-Optik (WLO), optische Sensoren und Projektoren, Automobilbeleuchtung, Waveguides für Augmented Reality-Headsets, biomedizinische Geräte, Meta-Linsen und Meta-Oberflächen sowie Optoelektronik. Der EVG7300 unterstützt Wafergrößen von bis zu 300 mm und verfügt über eine hochpräzise Justiergenauigkeit und fortschrittliche Prozesskontrollmöglichkeiten bei gleichzeitig hohem Durchsatz. Damit erfüllt das System die Anforderungen für die Großserienfertigung einer Vielzahl von nano- und mikrooptischen Freiform- und Hochpräzisionskomponenten und -Geräten.

"Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der der Nanopräge-Technologie leistet EV Group auch weiterhin Pionierarbeit in diesem Schlüsselbereich, um innovative Lösungen zu entwickeln, die den sich stetig weiterentwickelnden Anforderungen unserer Kunden gerecht werden", so Dr. Thomas Glinsner, Corporate Technology Director bei EV Group. "Das neueste Mitglied unserer Nanoimprint-Produktfamilie, der EVG7300, vereint unsere vollflächige SmartNIL Imprint-Technologie mit dem Linsenformen und Stapeln von Linsen in einem hochmodernen System mit der präzisesten Justiergenauigkeit und Prozessparameterkontrolle auf dem Markt. Damit bieten wir unseren Kunden eine beispiellose Flexibilität für ihre industriellen Forschungs- und Produktionsanforderungen."

Das EVG7300-System wird sowohl als eigenständiges Gerät als auch als Modul in EVGs vollintegriertem HERCULES® NIL UV-NIL Track-System angeboten, welches je nach Konfiguration zusätzliche Vorprozesse wie Reinigung, Fotoresist-Belackung und -Aushärtung sowie nachgereichte Prozesse beinhaltet, um den jeweiligen Prozessanforderungen gerecht zu werden. Das System zeichnet sich durch eine branchenweit führende Justiergenauigkeit (bis zu 300 nm) aus, die durch eine Kombination aus verbesserten Justiertischen, hochpräzisen Optiken, Mehrpunkt-Spaltkontrolle, berührungsloser Spaltnessung und Mehrpunkt-Kraftkontrolle ermöglicht wird. Der EVG7300 ist eine hochflexible Plattform, die drei verschiedene Prozessmodi (Linsenprägung, Linsenstapelung sowie SmartNIL Nanoprägetechnologie) bei gleichzeitiger Unterstützung für Substratgrößen von 150 mm- bis 300 mm-Wafern bietet. Schnelles Laden von Stempeln und Wafern, schnelle Ausrichtungsoptiken, Hochleistungs-aushärtung und ein kleiner Platzbedarf für das System ergeben eine hocheffiziente Plattform, welche die Produktionsanforderungen der Industrie für kommende WLO-Produkte erfüllt.



### **Produktverfügbarkeit**

EVG nimmt derzeit bereits Bestellungen für das System entgegen. Produktdemonstrationen sind ab sofort im NILPhotonics®-Kompetenzzentrum von EVG am Firmensitz möglich. Weitere Informationen über das automatisierte SmartNIL Nanoimprint- und Wafer-Level-Optik-System EVG7300 finden Sie unter <https://www.evgroup.com/products/nanoimprint-lithography/uv-nil-smartnil/evg-7300/>.

### **EVG auf der SPIE AR/VR/MR 2022**

Kommende Woche hält EVG einen Gastvortrag über die Vorteile von NIL bei der Herstellung von Augmented Reality-Waveguides auf der SPIE AR/VR/MR Conference and Exhibition, die zeitgleich mit der SPIE Photonics West vom 22. bis 27. Januar im Moscone Center in San Francisco abgehalten wird. EVG ist auch als Aussteller auf der Veranstaltung vertreten und wird seine hochentwickelten Fertigungslösungen für optische und photonische Geräte und Anwendungen vorstellen.

### **Über EV Group (EVG)**

Die EV Group (EVG) ist anerkannter Technologie- und Marktführer für Präzisionsanlagen und Prozesslösungen zur Waferbearbeitung in der Halbleiterindustrie, Mikrosystemtechnik und Nanotechnologie. Zu den Kernprodukten gehören Waferbonder, Systeme zur Dünnyafer-Bearbeitung, Lithographie- und Nanoprägelithographie-Systeme sowie Fotoresist-Belacker, Reinigungs- und Metrologiesysteme. Das 1980 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in St. Florian am Inn (Austria) beschäftigt mehr als 1100 Mitarbeiter und betreut mit eigenen Niederlassungen in USA, Japan, Korea, China und Taiwan sowie Repräsentanzen namhafte Produktionskunden und R&D-Partner in aller Welt.

Für mehr Informationen siehe [www.EVGroup.com](http://www.EVGroup.com)

### **Kontakte:**

Clemens Schütte  
Director, Marketing and Communications  
EV Group  
Tel: +43 7712 5311 0  
E-mail: [Marketing@EVGroup.com](mailto:Marketing@EVGroup.com)

David Moreno  
Principal  
Open Sky Communications  
Tel: +1.415.519.3915  
E-mail: [dmoreno@openskypr.com](mailto:dmoreno@openskypr.com)

# #